



国家纳米科学中心

National Center for Nanoscience and Technology

研精闡微
為民關用
白春禮

[首页](#) | [单位概况](#) | [人才队伍](#) | [科研成果](#) | [合作交流](#) | [研究生教育](#) | [党群建设](#) | [科学传播](#) | [仪器设备](#) | [信息公开](#)

当前位置: [首页](#) > [科研成果](#)

科研成果

> [论文](#)

> [专利](#)

> [标准](#)

> [专著](#)

> [获奖成果](#)

科研成果

一种光学灰度掩模及其制作方法

专利名称:	一种光学灰度掩模及其制作方法
英文名称:	一种光学灰度掩模及其制作方法
专利类别:	发明
申请号:	200980111157.9
申请日期:	2009-10-23
授权日期:	2012-05-09
专利号:	ZL200980111157.9
第一发明人:	郭传飞
其它发明人:	刘前; 曹四海; 王永胜
专利授权日期:	2012-05-09
关闭窗口 返回首页	

[理事单位](#) | [机构设置](#) | [挂靠单位](#) | [博士后流动站](#) | [招生咨询](#) | [主任信箱](#) | [违纪违法举报](#) | [友情链接](#)



中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

版权所有 © 2017-2018 国家纳米科学中心 京ICP备05064431号-1 京公网安备:

110402500013

地址: 北京市海淀区中关村北一条11号 邮编: 100190

电话: 010-62652116 传真: 010-62656765 Email: webmaster@nanoctr.cn

